

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
1. Februar 2001 (01.02.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/08200 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 21/00[DE/DE]; Hagäckerweg 8, D-71144 Steinenbronn (DE).
SCHNEIDER, Jens [DE/DE]; Neckartenzlingerstrasse
42, D-72766 Reutlingen (DE). MEURIS, Marc [BE/BE];
Kapeldreef 75, B-3001 Leuven (BE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/06716

(22) Internationales Anmeldedatum:
14. Juli 2000 (14.07.2000)(81) Bestimmungsstaaten (*national*): JP, KR, SG, US.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE).

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
199 34 300.4 21. Juli 1999 (21.07.1999) DE

Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist: Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

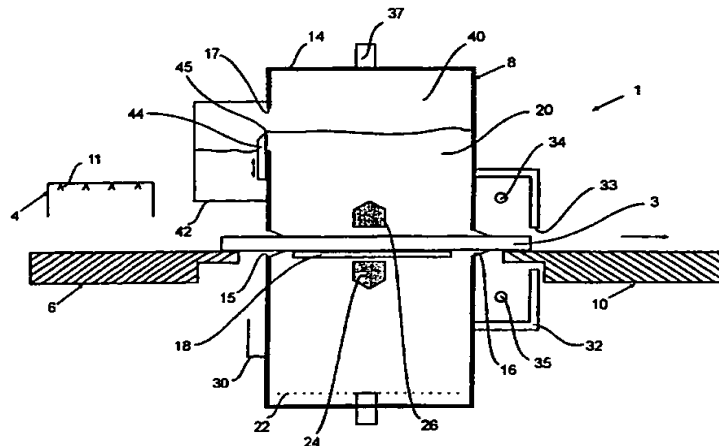
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): STEAG MICROTECH GMBH [DE/DE];
Carl-Benz-Strasse 10, D-72124 Pliezhausen (DE). IMEC
[BE/BE]; Kapeldreef 75, B-3001 Leuven (BE).Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SPEH, Ulrich

(54) Title: DEVICE FOR TREATING SUBSTRATES

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM BEHANDELN VON SUBSTRATEN



(57) Abstract: The aim of the invention is to attain a uniform and homogeneous treatment of substrates in a device comprising at least one process container which is arranged in a gas atmosphere and which contains a treatment fluid. Said process container also comprises at least two openings which are located underneath a treatment fluid surface and through which the substrates are linearly guided. In addition, an overflow for the treatment fluid is provided.

(57) Zusammenfassung: Zum Erreichen einer gleichmässigen und homogenen Behandlung von Substraten in einer Vorrichtung mit wenigstens einem in einer Gasatmosphäre angeordneten, ein Behandlungsfluid enthaltenden Prozessbehälter, der wenigstens zwei unterhalb einer Behandlungsfluidoberfläche liegende Öffnungen zum linearen Durchführen der Substrate aufweist, ist ein Überlauf für das Behandlungsfluid vorgesehen.

WO 01/08200 A1